

- [2] Манаков Н.А., Толмачев В.В., Сахаев К.С. // Изв. вузов. Черная металлургия. 1988. № 6. С. 85-87.
- [3] Иванова Е.В., Любушкина Л.М., Манаков Н.А. // Металлофизика. 1989. Т. 11. № 1. С. 8-12.

Поступило в Редакцию
20 ноября 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 3

12 февраля 1990 г.

11

(C) 1990

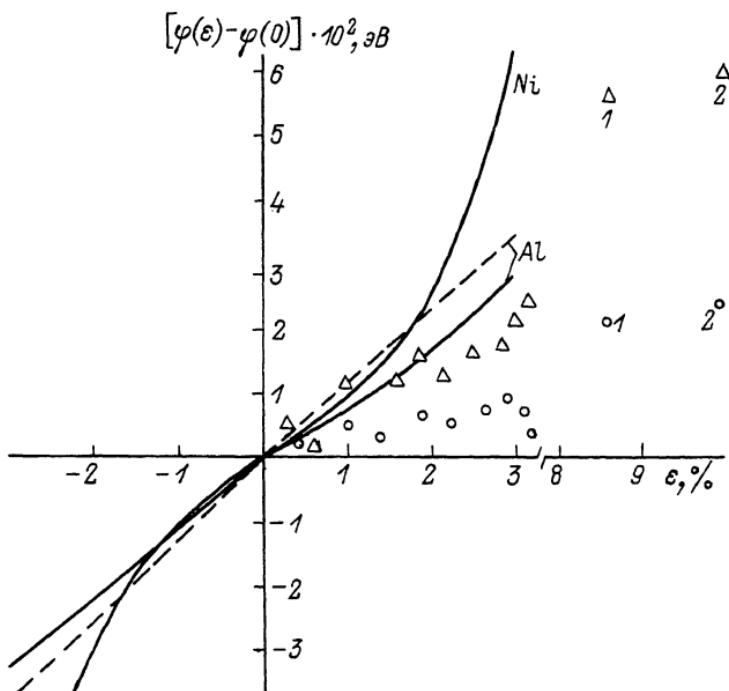
О ТЕНЗОЭМИССИОННОМ ЭФФЕКТЕ В МЕТАЛЛАХ

В.В. Погосов, В.В. Левитин,
С.В. Лоскутов

Работа выхода электрона сильно зависит от состояния поверхности, а точнее от электронного строения приповерхностных слоев атомов, фактически осуществляющих эмиссию электронов. Это подтверждают многочисленные эмпирические и полуэмпирические зависимости между работой выхода φ и физико-химическими свойствами твердого тела [1]. Многочисленные исследования тем не менее не позволяют ответить на вопрос о характере влияния механических напряжений на локальную работу выхода [1, 2]. Ответу на этот вопрос и посвящено настоящее сообщение.

1. Создана экспериментальная установка, позволяющая проводить методом КРП измерения φ непосредственно в процессе деформации ε металлических образцов. Нагружение образцов проводилось с постоянной скоростью в интервале 0.02-22.0 мкм/с. Максимальная нагрузка составляла 3 кН. Значения φ в каждой точке определялись десятикратно. Относительная погрешность измерения φ составляла 0.03% при доверительной вероятности 0.95. В ходе экспериментов измерение деформации ε и φ осуществлялось одновременно. Исследовались листовой алюминий и никель.

2. На рис. 1 представлены данные, иллюстрирующие влияние активного растяжения образцов на работу выхода электронов. Зависимость напряжения от деформации при этом носит обычный характер. Для упруго деформированных образцов характерны немонотонные зависимости $\varphi(\varepsilon)$ с тенденцией к росту работы выхода. Эти осцилляции, вероятно, связаны с неоднородностью деформирования в микрообъемах металла. После перехода в область неупругих



Экспериментальные и расчетные зависимости $\varphi(\varepsilon)$: Δ - Al
 \circ - Ni точки 1, 2 соответствуют пластической области;
сплошные монотонные кривые - расчет с пробной функцией (2);
штриховая - с функцией (3) для Al; $\nu = 0.36$ (Al),
 $\nu = 0.3$ (Ni).

деформаций ($\varepsilon \gtrsim 3\%$) работа выхода при активном растяжении начинает уменьшаться. Активное продвижение в пластическую область можно рассматривать как постепенную накачку дефектами приповерхностного слоя металла. С другой стороны, в результате экспериментов с проведением последовательных циклов нагрузок и разгрузок в пластической области можно получить на графике $\varphi(\varepsilon)$, например точки 1 и 2, соответствующие $\varepsilon = 8.7\% \text{ и } 10\%$ соответственно. Эти точки являются результатом многочасовых разгрузок, т.е. получены после окончания релаксационных процессов на поверхности. Таким образом, с ростом числа дефектов вблизи равновесной поверхности растет и работа выхода.

Наблюдаемые в процессе активной деформации изменения φ являются результатом протекания нескольких конкурирующих процессов: изменений межатомного и межплоскостного расстояний и связанных с этим изменений электронной плотности (эти факторы, очевидно, играют основную роль для упругой области); выхода деформирующих дислокаций на поверхность; изменения плотности дислокаций в приповерхностном слое.

3. Для выяснения механизмов, формирующих наблюдаемую зависимость $\varphi(\varepsilon)$ проведено теоретическое исследование влияния упругих деформаций на энергетические характеристики металла. Для этого модифицирована модель [3], предназначенная для вычисления φ недеформированного монокристалла. Рассматривалась деформация в направлении [100], а работа выхода рассчитывалась в [010]. Объем элементарной ячейки задавался в виде

$$V = V_0 [1 - (1-2\nu)\varepsilon] + O(\varepsilon^2),$$

где ν – коэффициент Пуассона (для Al использованы $\nu = 0.36$, 0.5, а для Ni $\nu = 0.3; 0.5$), $V_0 = a_0^3$, a_0 – период решетки в ненапряженном состоянии, $a = a_0(1+\varepsilon)$. Для расчетов необходимы также: концентрация электронов в единице объема $n^+ = 12/V$; среднее расстояние d между атомными плоскостями в направлении [010], $d = a_0(1-\nu\varepsilon)/2$; расстояние c между ближайшими соседями в этих плоскостях, $c = a_0[1 + (0.5 - \nu)\varepsilon]/\sqrt{2}$. Распределение электронной плотности задавалось пробными функциями

$$n_r(z) = n^+ / [1 + \exp(b_r z)], \quad (2)$$

$$n_z(z) = n^+ \{ [1 + 0.5 \exp(b_z z)] \theta(-z); 0.5 \exp(-b_z z) \theta(z) \}. \quad (3)$$

Значения $b(\varepsilon)$ находились из условия минимума поверхностной энергии. Работа выхода электронов в направлении [010] определялась нами как сумма

$$\varphi = \varphi_j + \varphi_{ps}, \quad (4)$$

где φ_j – составляющая в модели железа (для нее использовались правила сумм [4]), φ_{ps} – соответствует первому порядку разложения энергии электрон-ионного взаимодействия по псевдопотенциальному Ашкрофта, параметр которого r_c находился из условия равенства нулю давления в металле при заданных значениях ε . Результаты вычислений φ для Al и Ni приведены на рис. 1. Для использованных значений ν с ростом ε работа выхода возрастает. Основными механизмами, обусловливающими рост φ , является уменьшение n^+ и d , что приводит к росту толщины поверхности слоя ($\sim b^{-1}$), т.е. к дополнительному „выплескиванию“ электронной жидкости за границу металла.

Самосогласованный и последовательный расчет дает возможность оценить изменение с деформацией каждого параметра. Например, с ростом ε величина φ_j стремится увеличить φ за счет уменьшения n^+ и b ; в то же время φ_{ps} стремится уменьшить φ по тем же причинам, а также за счет роста r_c и уменьшения d . Указанные механизмы не зависят от индексов плоскостей, поэтому можно говорить о качественном согласии расчетных и экспериментальных значений φ .

Использованная модель обладает неплохими экстраполяционными свойствами, что позволяет описывать напряженное состояние металла не на языке дефектов, а с помощью параметров a , d , c .

Список литературы

- [1] Фоменко В.С. Эмиссионные свойства химических элементов и их соединений. Киев: Наукова думка, 1980. 330 с.
- [2] Кашенко М.П., Крюк В.И. // ЖТФ. 1979. Т.49. № 1. С. 181-183.
- [3] Lang N.D., Kohl W. // Phys. Rev. B. 1971. V. 3. N 4. P. 1215-1223.
- [4] Погосов В.В. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 8. С. 2310-2313.

Поступило в Редакцию
25 июля 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 3

12 февраля 1990 г.

05.4; 09

© 1990

ЗАТУХАНИЕ СПИНОВЫХ ВОЛН В СТРУКТУРЕ ФЕРРИТ-СВЕРХПРОВОДНИК

О.А. Чивилева, А.Г. Гуревич,
А.Н. Анисимов, С.Ф. Карманенко

Распространение спиновых волн в структурах, содержащих ферритовые и диэлектрические слои и металлические поверхности, довольно подробно исследовано (см., например, работы [1-3]). В этих теоретических работах рассматривался идеальный металл (удельное сопротивление $\rho = 0$), основное внимание уделялось влиянию металлической поверхности на дисперсию спиновых волн.

В работе [4] исследовалось затухание поверхностных спиновых волн в пленке железо-иттриевого граната (ЖИГ) в зависимости от поверхностного сопротивления $R_{\text{пов}}$ металлического слоя, нанесенного на пленку ЖИГ. Как и следовало ожидать, в предельных случаях $R_{\text{пов}} \rightarrow 0$ и $R_{\text{пов}} \rightarrow \infty$ затухание поверхностных волн было минимальным, максимум затухания имел место при $R_{\text{пов}}$, измеряющем десятками Ом.

К настоящему времени получены высококачественные пленки высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на различных подложках, исследованы их электрические свойства. В связи с этим возник интерес к исследованию структур типа пленка ЖИГ - пленка